



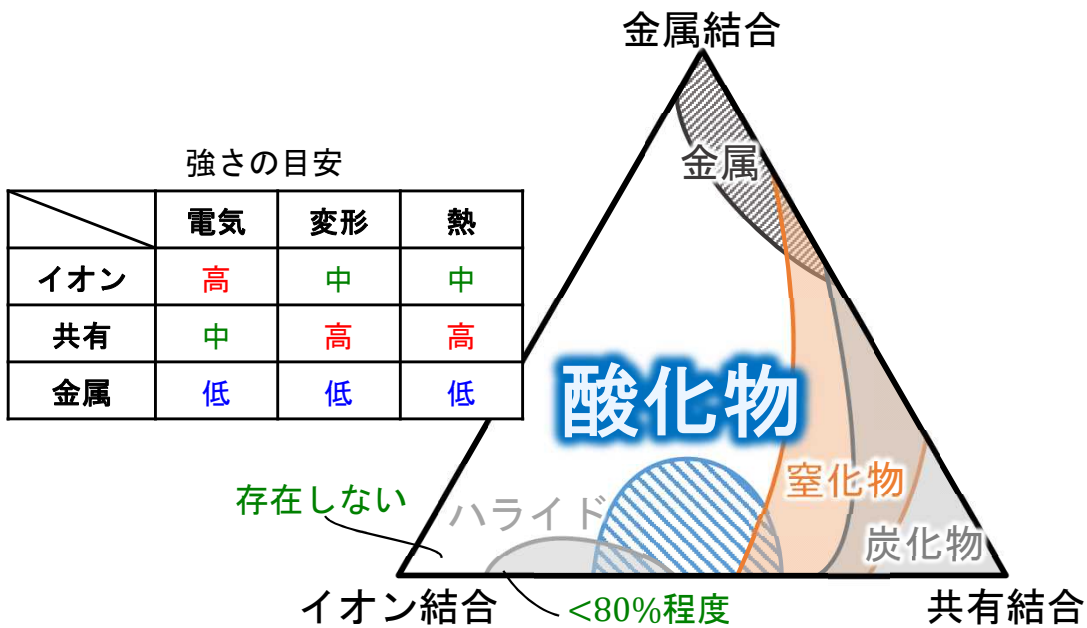
金属酸化物薄膜

Advanced Fabrication System for Metal Oxide Thin Films

の成膜装置

第63回応用物理学会春季学術講演会 東京工業大学 大岡山キャンパス
平成28年3月21日(月) 13:00~18:15 (21p-S222)

金属酸化物は、共有結合性およびイオン結合性、両結合性を備える材料です。そのため非常に特異な機能を発し将来的な活躍が期待される一方、高品質な薄膜の作製はかなり困難です。そこで本シンポジウムは、実際に装置を開発されているエンジニアの方に成膜装置についてご講演していただき、聴衆者に金属酸化物薄膜作製装置のコア技術に関する理解を深めて頂ければ、という思いから開催に至りました。双方向的な議論を行う事により、金属酸化物薄膜が現在抱えている課題の共有化、解決する方向性や手段を見出していただければ幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。



招待講演 (敬称略)

【座長】 山本 哲也 (高知工大)、大友 明 (東工大)

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 川崎 雅司 (東大工) | 成膜技術の革新が支えた酸化物エレクトロニクス発展とその未来 |
| 藤原 康文 (阪大院工) | スパッタリング併用有機金属気相堆積法と希土類添加ZnOへの応用 |
| 赤沢 方省 (NIT/DIC) | ECRプラズマスパッタ法による金属酸化物薄膜形成 |
| 鈴木 巧一 (サテック/ラジエック) | ドイツにおけるスパッタ技術の最新動向 |
| 木下 公男 (住友重機械工業) | 反応性プラズマ蒸着 (RPD)装置 |
| 藤村 紀文 (大阪府立大) | 常圧非平衡プラズマを用いた新規な酸化物薄膜の化学気相成長プロセス |
| 安田 隆 (石専大理工) | ゾル・ゲル法による酸化物半導体混晶および積層構造の作製 |
| 生田 目俊秀 (物材機構) | 原子層堆積法で作製した金属酸化物薄膜の電子デバイスへの展開 |
| 塚崎 敦 (東北大金研) | 分子線エピタキシー法を用いた酸化物系ヘテロ構造の作製と物性 |

【企画】 合同セッションK 【世話人】 川原村 敏幸 (高知工大) 阿部友紀 (鳥取大学)